

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI PER STRATI ATOMICI ASSISTITO DA PLASMA (PLASMA ENHANCED ATOMIC LAYER DEPOSITION – PEALD), FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1

PROGETTO iENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006 - CIG 9919415037 - CUI F80054330586202300345

**IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO**

Attesta che il link alla pagina della BDNCP di ANAC sulla quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni relativi alla procedura sopra individuata è il seguente:

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9919415037&standalone=2

Il Direttore

dott. Andrea Zappettini